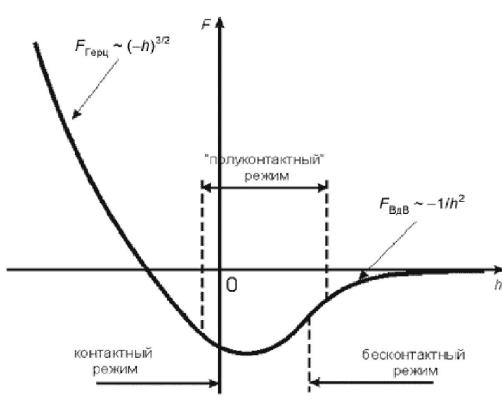


### Физические основы метода АСМ



Сила зонд - образец

$$\overline{F}_{PS} = -grad(W_{PS})$$

Потенциал Леннарда-Джонса

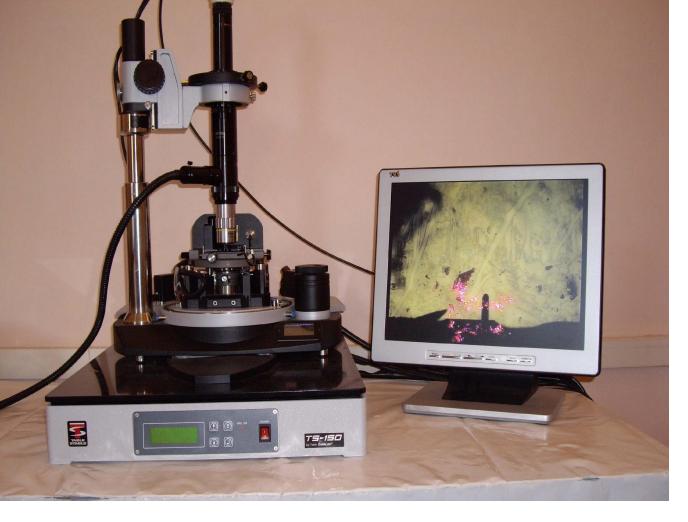
$$U_{LD}(h) = U_0 \left\{ -2\left(\frac{h_0}{h}\right)^6 + \left(\frac{h_0}{h}\right)^{12} \right\}$$

 $U_0$  — значение энергии в минимуме,  $h_0$  — равновесное расстояние между атомами

Энергия взаимодействия

$$W_{PS} = \int_{V_P} \int_{V_S} U_{LD}(h-h')n_P(h')n_S(h)dVdV'$$

 $n_S(h)$  и  $n_P(h')$  — плотности атомов в материале образца и зонда

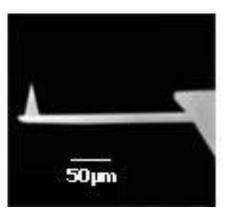


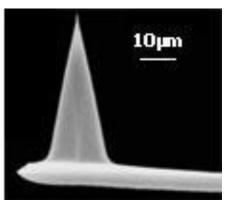
### Атомно-силовой микроскоп NTEGRA

Фирма NT-MDT, Зеленоград

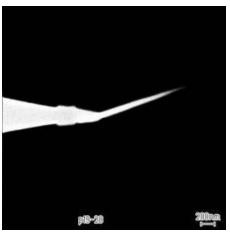
Производства 2005 года

## Кантилеверы

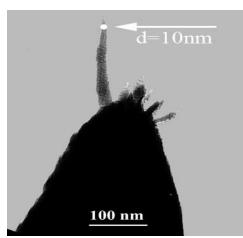




Базовый кантилевер NSG10 R ≈ 10 нм.



"Вискерный" кантилевер NSC05/5  $R \approx 1-2.5 \text{ нм}$ 



"Вискерный" кантилевер NSG01\_DLC/10  $R \approx 1$  нм

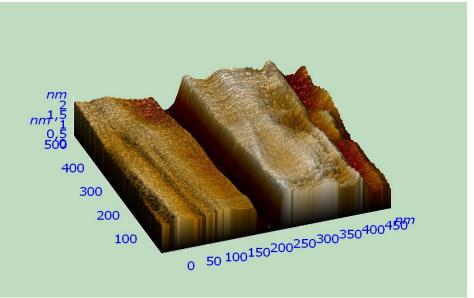
### Высокоориентированный графит НОРС

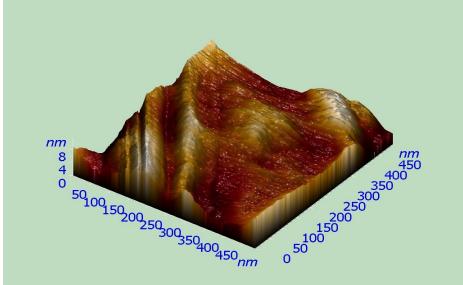


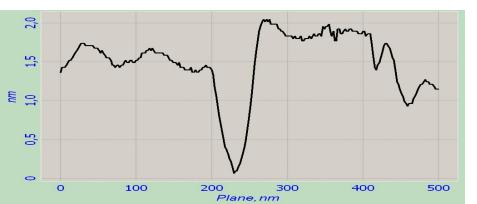
"Вискерный" кантилевер NSG01\_DLC/10  $R \approx 1$  нм

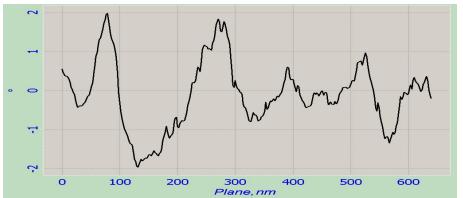


"Вискерный кантилевер NSC05/5 R ≈ 1-2.5 нм





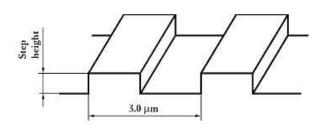




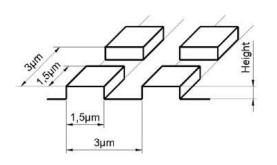
# Достоверность результатов контролировалась эталонными решетками:

# **Эталонные** решетки

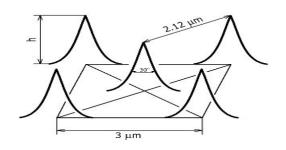
•TGZ1, TGZ2, TGZ3 – прямоугольные профили, h= 23, 112, 545 нм, соответственно;



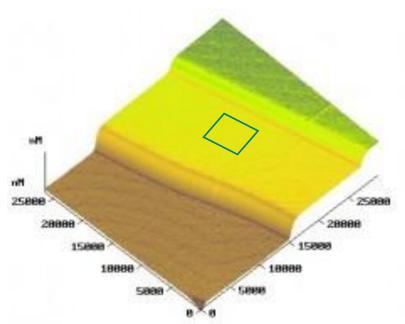
• TGQ1 – квадратные выступы, h= 19.5 нм;



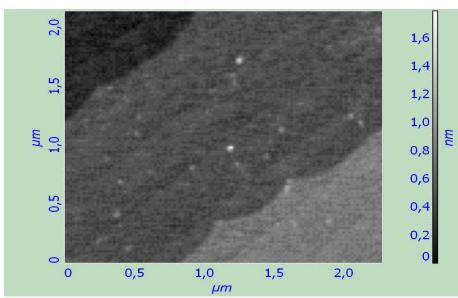
•TGT1 – конические пики, h=400 нм, угол при вершине  $30^{\circ}$ 

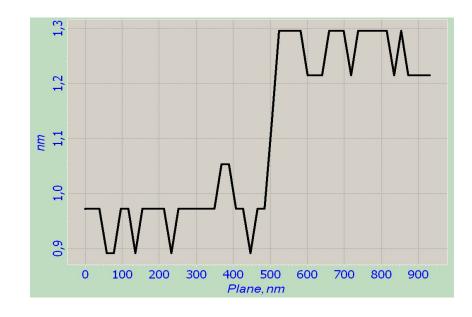


### Монокристалл кремния STEPP



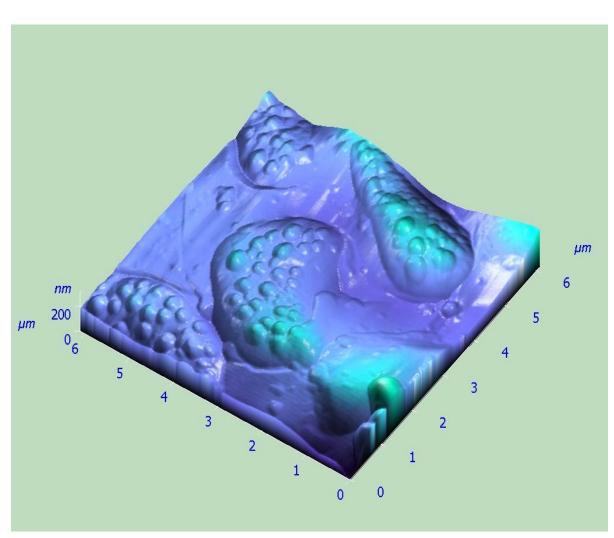
- •Высота одноатомной ступени 0,314 нм
- •Средняя шероховатость площади без одноатомных ступеней 0,06 нм
- •Эталон является предельным для метода
- •Требуется совместная юстировка кантилевера, сканера и эталона
  - •Фирма NT-MDT дала заключение предельное разрешение получено





Разрешение межплоскостных ступенек 0,31 нм

### Защитные покрытия на углеродные материалы



Обеспечивается защита углеродных материалов в экстремальных условиях при температурах выше 1400 °C

Авиакосмическая техника, цветная и черная металлургия

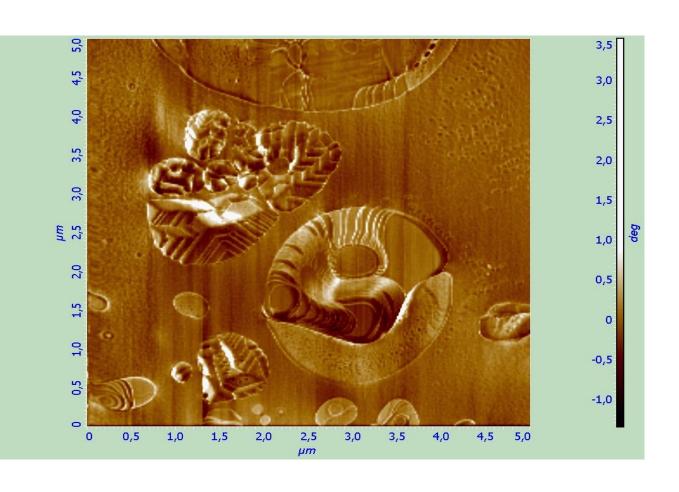
### Буран



Состояние теплозащиты после приземления

# Защитные покрытия на углеродные материалы нового поколения

Формирование покрытий в процессе входа изделия в эксплуатацию (реакционный синтез)

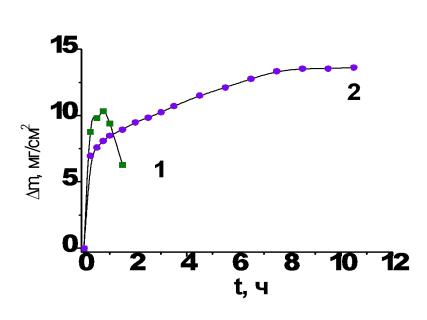


$$ZrB_2$$
 -  $MoSi_2$  -  $SiO_2$  1400 C, 30 мин

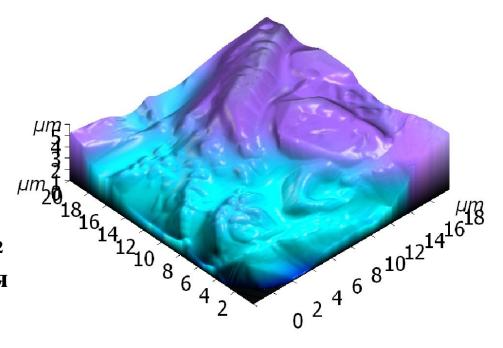
Зарождение и рост кристаллов

$$\begin{split} \mathsf{ZrB}_2 + \mathsf{O}_2 &\rightarrow \mathsf{ZrO}_2\\ \mathsf{MoSi}_2 + \mathsf{O}_2 &\rightarrow \mathsf{MoO}_3 \uparrow + \mathsf{Si}\\ \mathsf{O}_2\\ \mathsf{ZrO}_2 + \mathsf{SiO}_2 &\rightarrow \mathsf{ZrSiO}_4 \end{split}$$

#### Газонепроницаемые стеклокерамические покрытия ZrB<sub>2</sub>-MoSi<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>



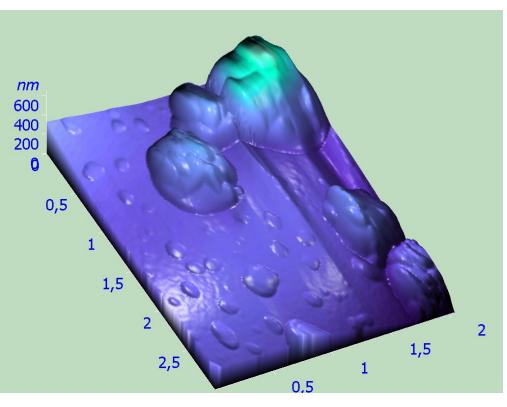
1 - ; 2 - SiO<sub>2</sub> Кварцевое стекло золь массы при 1100° Установлено, что использование наночастиц SiO<sub>2</sub> позволяет снизить температуру синтеза с 1400 до 1100°C

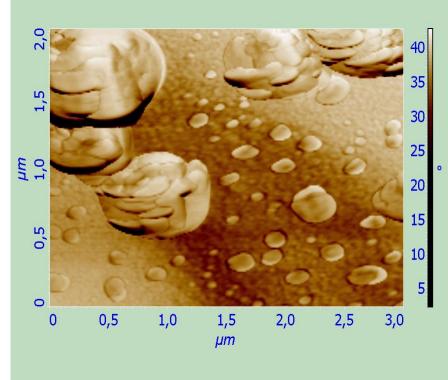


Остеклованная поверхность покрытия  $70ZrB_2$ - $30MoSi_2$ -  $SiO_2$ , полученного при температуре 1100

# Покрытия для защиты углеродных материалов системы TiB,-MoSi,

### Газонепроницаемые стеклокристаллические слои



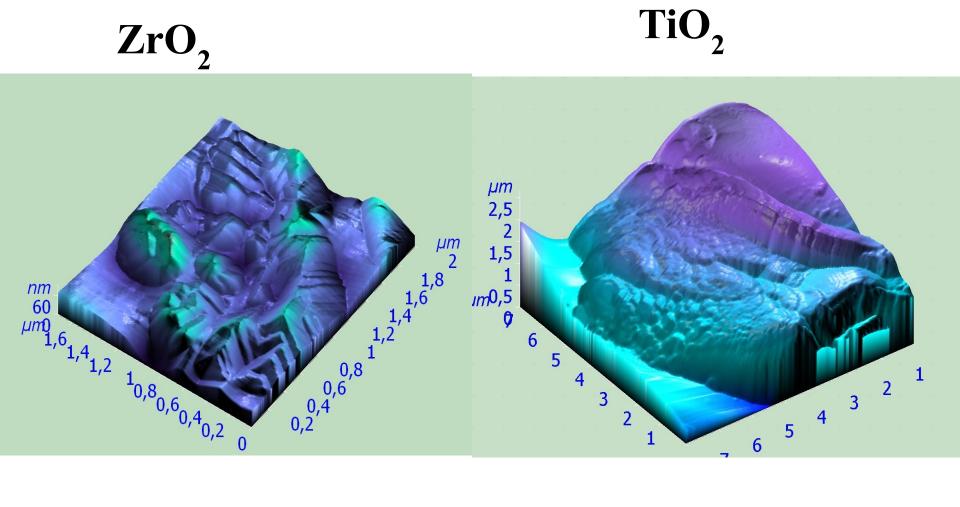


Топография в 3D-формате

В режиме фазового контраста

$$TiB_2 + MoSi_2 + O_2 \rightarrow TiO_2 + MoO_3 \uparrow + B_2O_3 \cdot SiO_2$$

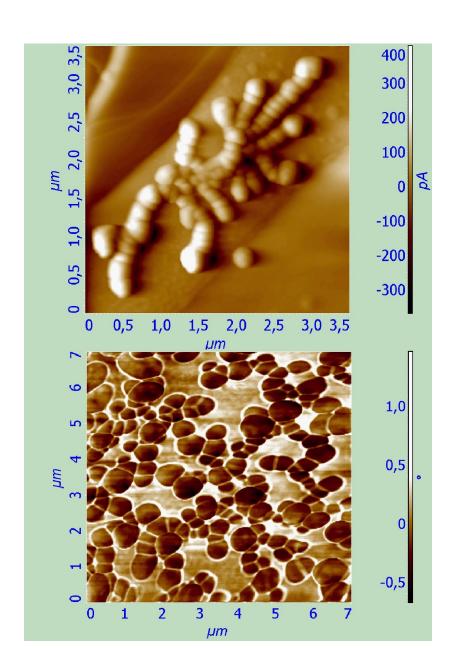
#### Структура реакционно-образовавшихся кристаллов в стекломатрице

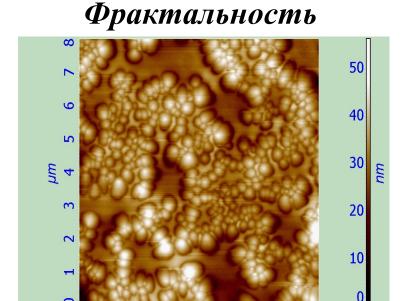


$$ZrB_2 + MoSi_2 + O_2 \rightarrow$$
  
 $ZrO_2 + MoO_3 \uparrow + B_2O_3 \cdot SiO_2$ 

$$TiB_2 + O_2 \rightarrow TiO_2 + B_2O_3$$

# Последовательное формирование зеренной поверхности тонкого слоя стекломатрицы

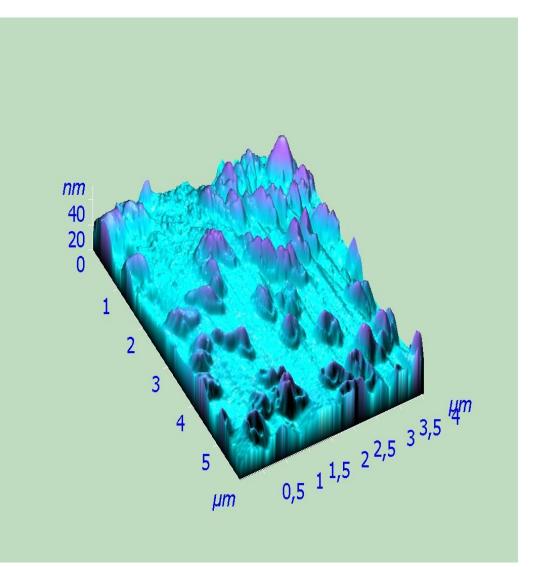




Цепочечные структуры, замыкающиеся в кольца, с последующим заполнением внутренних областей. Толщина слоя 30-50 мкм

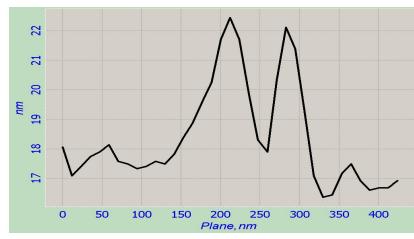
μm

## Окисление MoSi<sub>2</sub> на воздухе



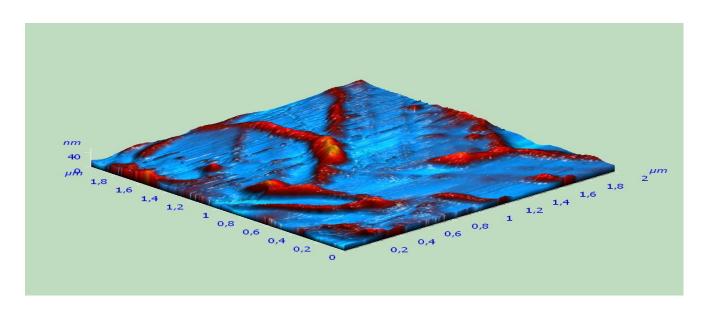
1400°С, 1 ч
$$MoSi_2 + O_2 \rightarrow MoO_3 \uparrow + SiO_2$$

Образование газонепроницаемой защитной силикатной пленки

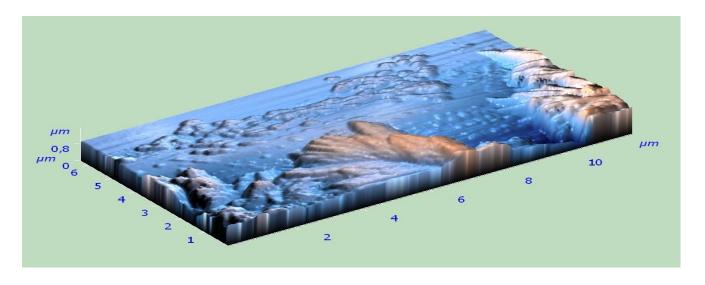


Кратеры газовыделения

### Исследование причин обрыва стекловолокна

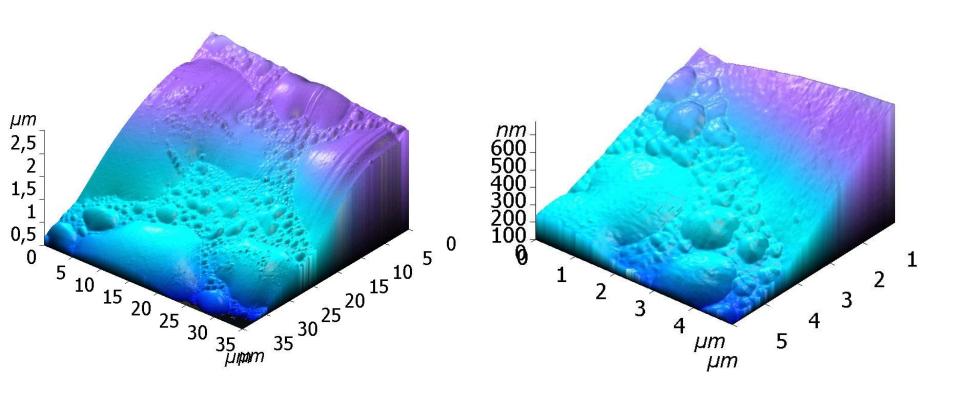


- качественное волокно
- (свили)

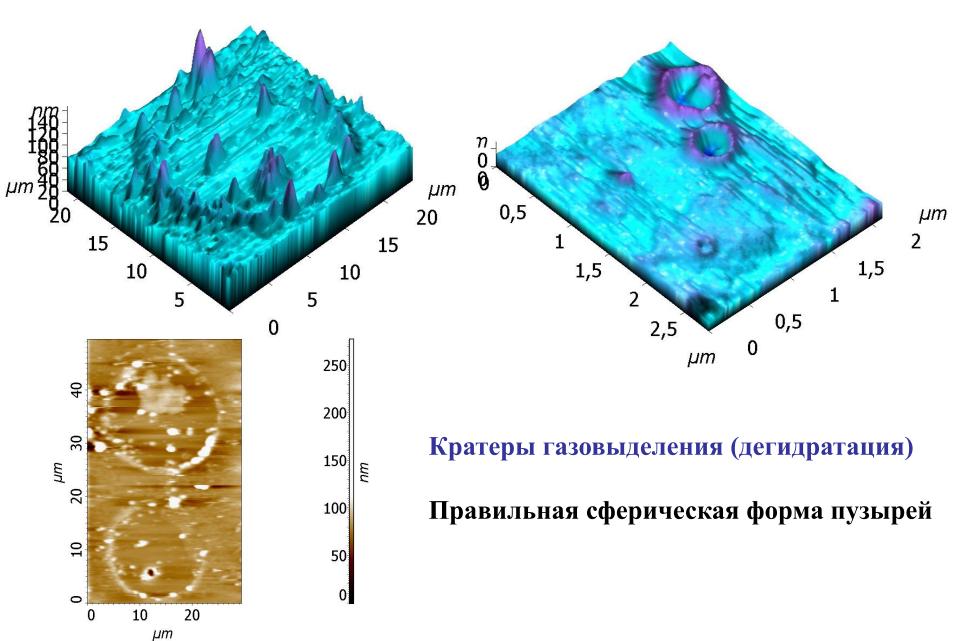


• Некачественное волокно, рвущееся вследствие кристаллизации (друзы кристаллов)

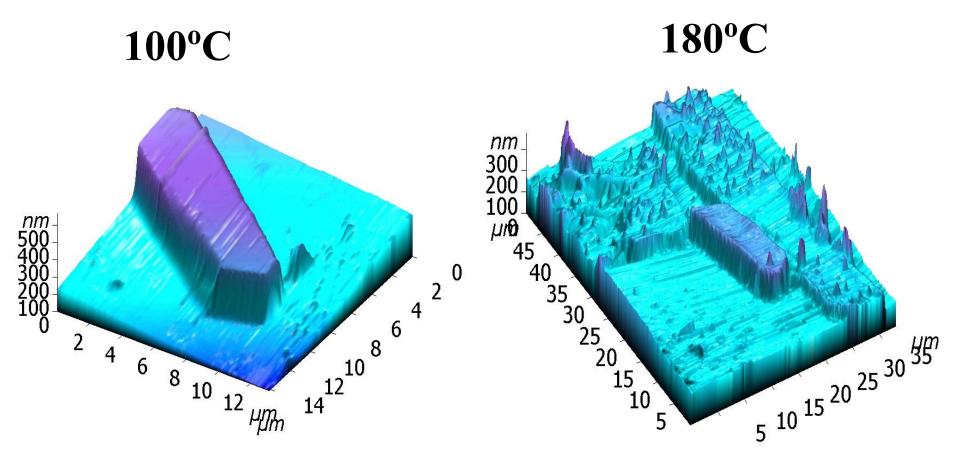
- Диаметр волокон
- ~ 50 мкм



Пузырение как результат газовыделения (дегидратации)



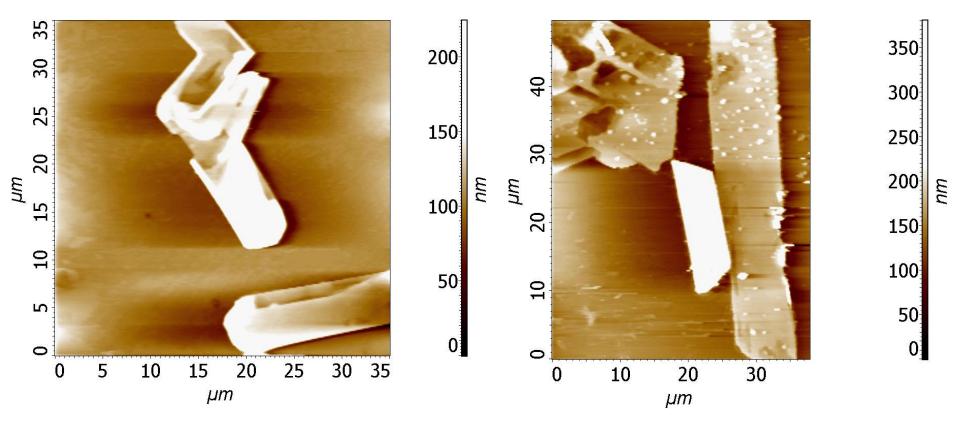
### Поверхностая кристаллизация при разных температурах



Кристаллы гидрокарбонатов

**Кристаллы гидрокарбонатов** и карбонаты

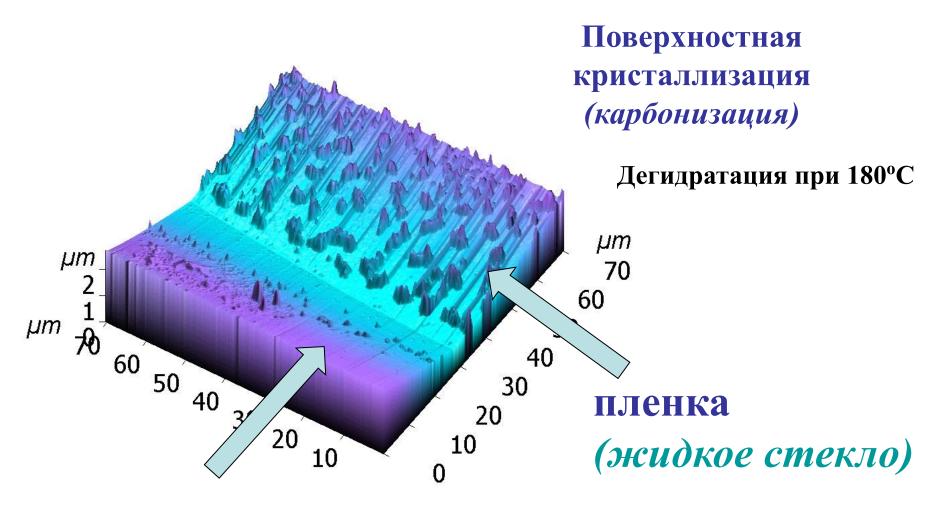
### Поверхностная кристаллизация



Кристаллы гидрокарбонатов

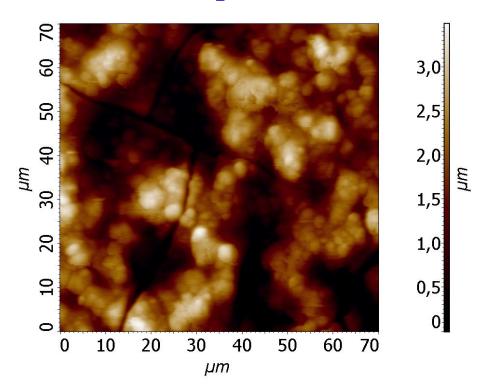
**Кристаллы гидрокарбоната** и карбонатов

Изображения в 3D-формате



подложка (боросиликатное стекло)

# Высокоотражающие оптические покрытия для лазерной техники на основе щелочных силикатов



Высокие отражательные свойства при температурах до  $1000^{\circ}$ C, воздействии электромагнитных излучений и радиационных нагрузках.

Золь-гель метод. Для низкотемпературного синтеза покрытий (150-250°С) используются гелеобразующие золи щелочных силикатов  $SiO_2$ - $R_2O$ ,  $R_2O$ = $Na_2O$ ,  $K_2O$ ,  $Na_2O$ - $K_2O$ ,  $Li_2O$ - $Na_2$ V- $K_2O$ ;  $SiO_2/R_2O$ = $3\div4$ .

Гетерогенная структура — частицы высокодисперсного оксидного наполнителя (MgO, ZrO₂, ZnO распределены в матрице силина прогостекла.

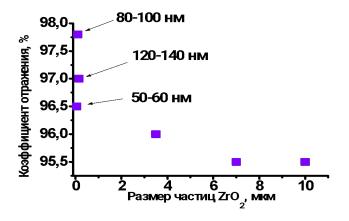
Синтезированные растворы R<sub>2</sub>O·nSiO<sub>2</sub>·mH<sub>2</sub>O

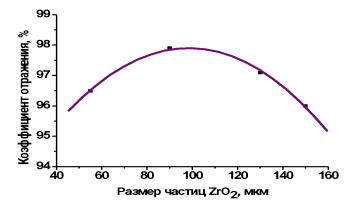
$$| -O-Si-O-Si-O + NaOH \Rightarrow [-O-Si-O-H]+[-O-Si-O-Na]$$

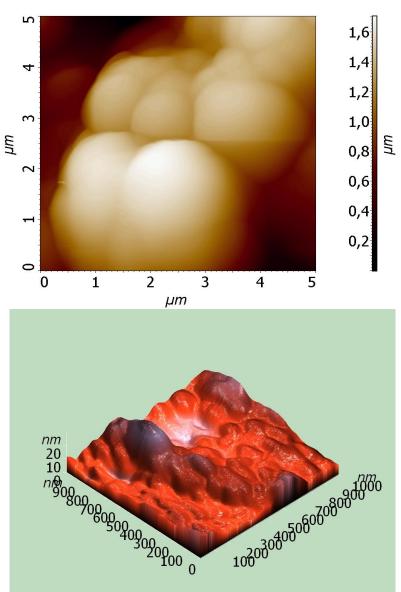
#### Влияние дисперсности частиц наполнителя на оптические свойства

#### Синтез наночастиц ZrO<sub>2</sub>

Температура разложения	Размер частиц
оксихлорида циркония, °С	ZrO <sub>2</sub> ,
600-650	50- <b>60</b> 1
750-800	80-100
900-1000	120-140

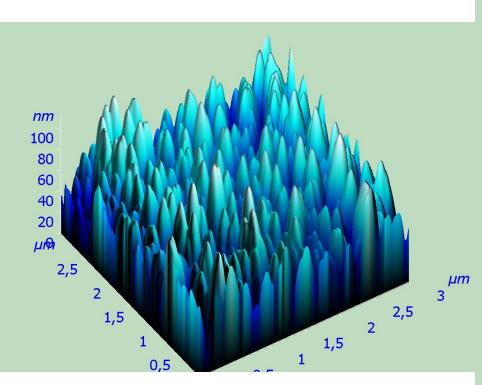




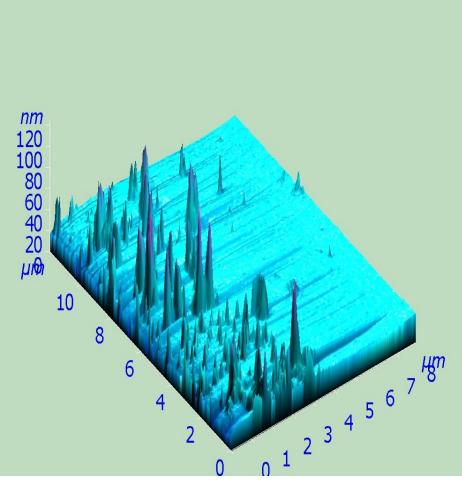


Ультра- и нанодисперсные частицы ZnO и ZrO<sub>2</sub> в матрице Na<sub>2</sub>O·3SiO<sub>2</sub>

### Кристаллизация аморфных металлических сплавов

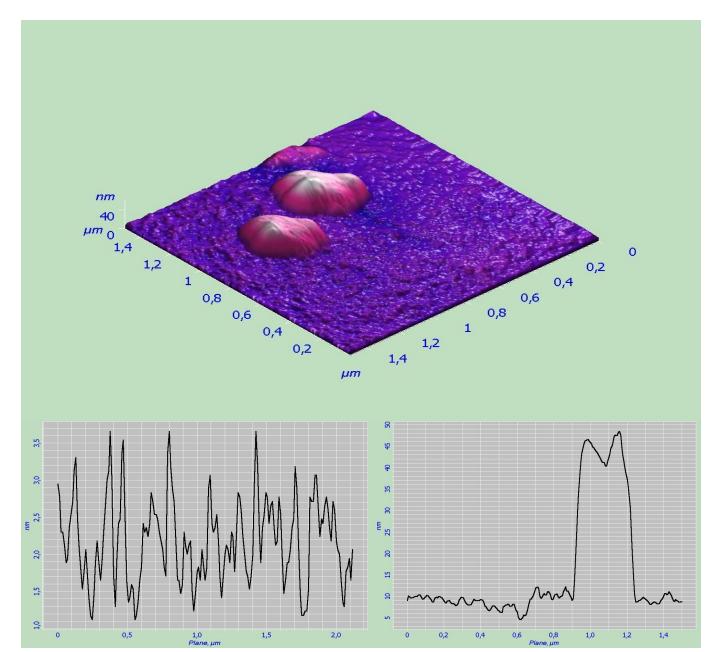


Полная кристаллизация, Отжиг 400оС, 1 ч



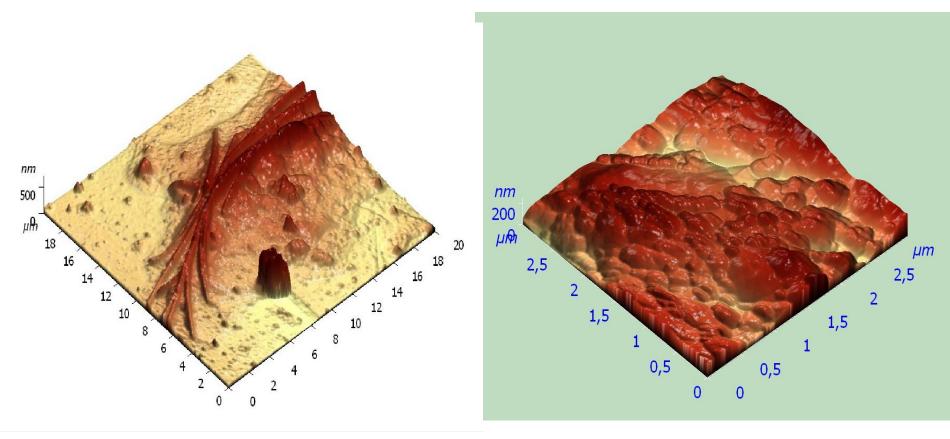
Зарождение и рост кристаллитов, Выдержка в течение 20 лет при комнатной температуре

### Аморфно-кристаллические пленки ZrO<sub>2</sub>



- Мембраны для топливных элементов водородной энергетики
- Электроннолучевое напыление
- Порошки ZrO<sub>2</sub>
  получены
  гидротермальным методом

### Огненно-полированная поверхность стекла

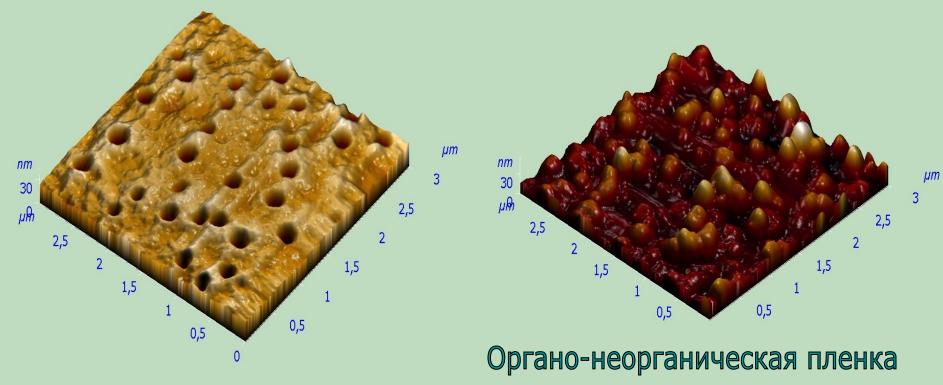


Характерные участки огненно-полированной поверхности боросиликатных стекол

Структуры, образовавшиеся в результате примесной кристаллизации высотой в сотни нанометров

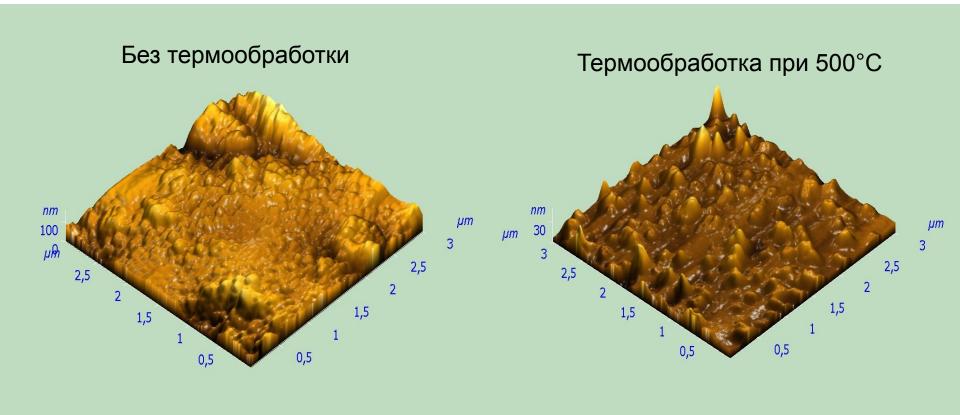
# Золь-гель пленки – источники диффузии бора в полупроводниковые материалы





Введение органических модификаторов в золи способствует изменению толщины и морфологии поверхности пленок.

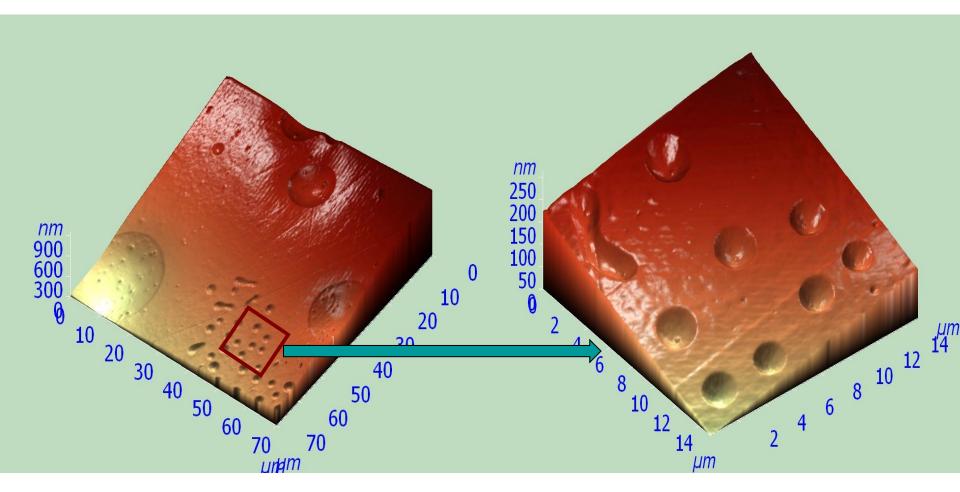
# Золь-гель пленки – источники диффузии редкоземельных элементов в полупроводниковые материалы



Разрыхление силикатной пленки, допированной гадолинием, в результате термообработки

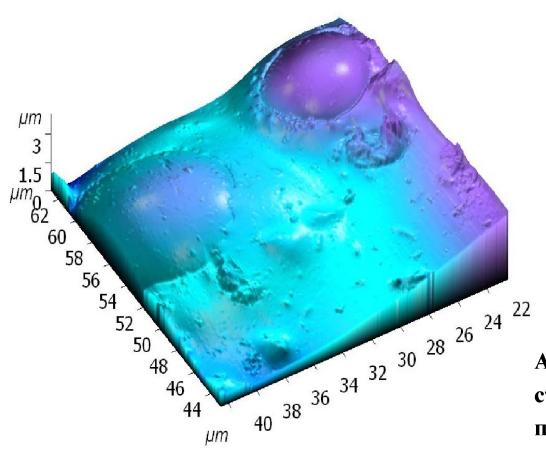
### Введение углеродных нановолокон в золь-гель покрытия

без использования поверхностно-активных веществ и У/З обработки



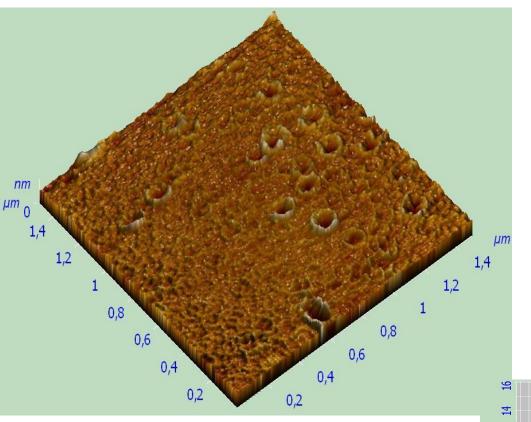
Шарообразные углубления, оставшиеся после клубков нановолокон

### Морфология органо-неорганического материала (стеклосферы в полимерной матрице)



Алюмоборосиликатные стеклосферы возвышаются над поверхностью материала и покрыты органической связкой. Показано хорошее смачивание стеклосфер полимерной матрицей.

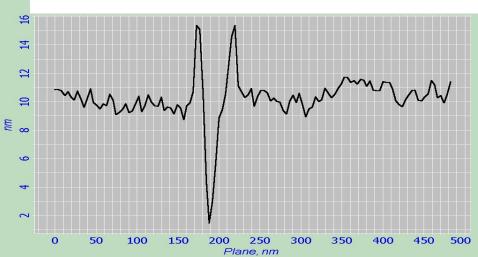
### Электретные пленки оксида тантала



Магнетронное реактивное напыление.

Биоимплантанты

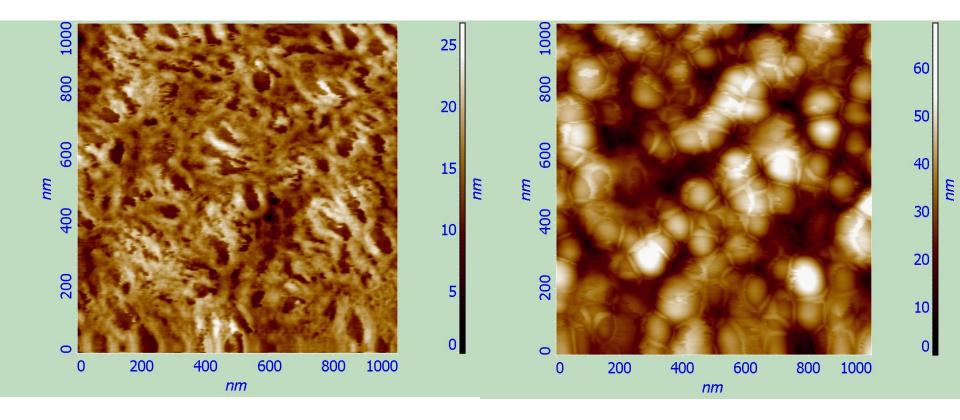
Кратеры в результате бомбардировки высокоэнергетичными ионами аргона



### Многослойные пленочные структуры

Влияние подслоя на топографию пленки

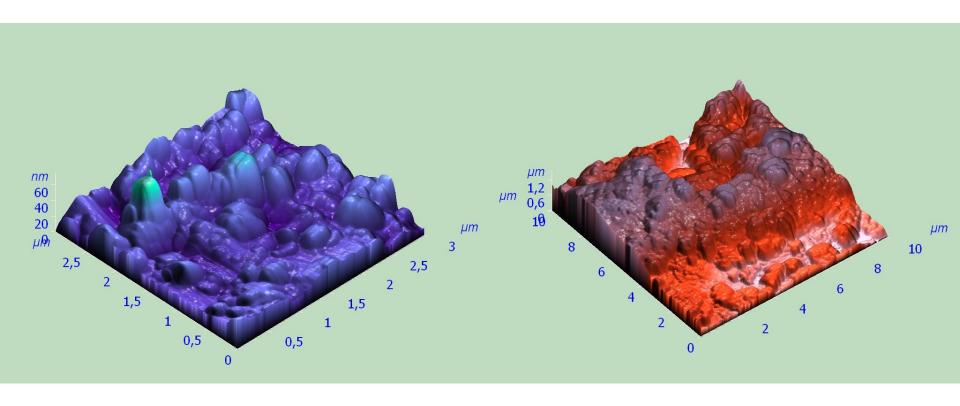
Магнетронное напыление Электретные свойства Биоимплантаты



 $Ta_2O_5 / Ta / Si$ 

Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> / Ti / Si

### Пленочные газовые сенсоры

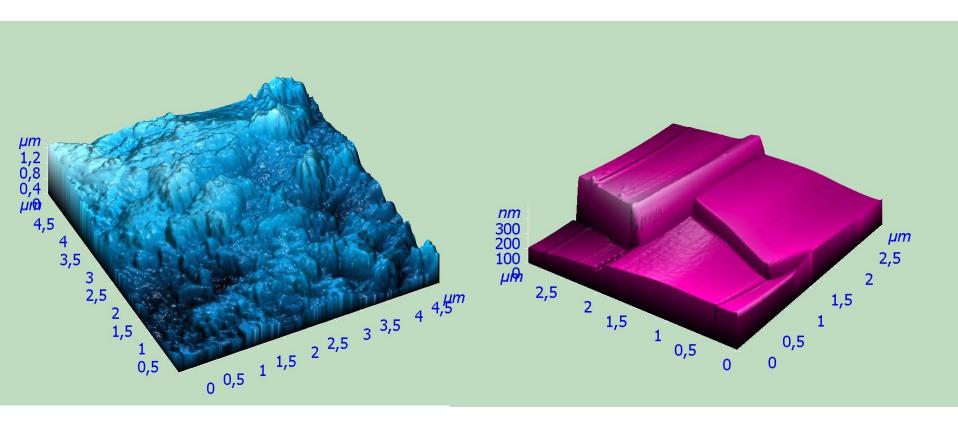


Ha основе PrO<sub>x</sub>

Ha основе CoO<sub>x</sub>

• Проблема "электронного носа"

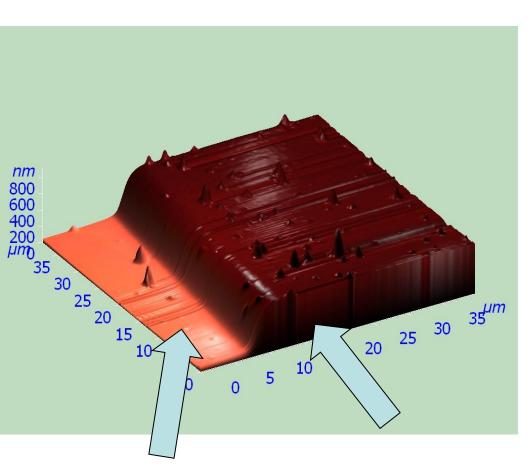
### Кристаллы фианитов



Грань поликристалла  $HfO_2(Y_2O_3)$ 

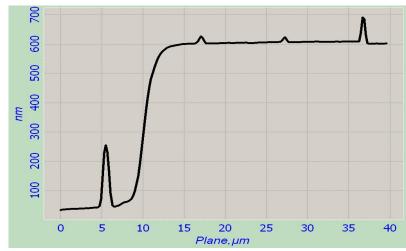
Кристаллические блоки фианита  $CeO_x(Y_2O_3)$ 

### Пленки Zr<sub>2</sub>Ln<sub>2</sub>O<sub>7±x</sub>, Ln=Nb,Pr,La



Электронно-лучевое напыление

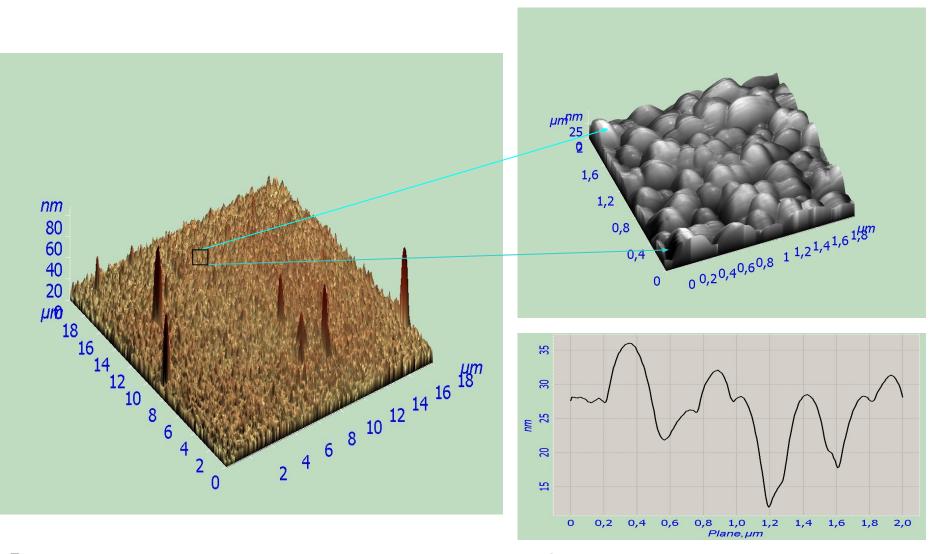
Проводящие покрытия с электронной и протонной проводимостью, катализаторы



пленка

Si-подложка

# Пленки $Zr_2Ln_2O_{7\pm x}$ , Ln=Nb,Pr,La

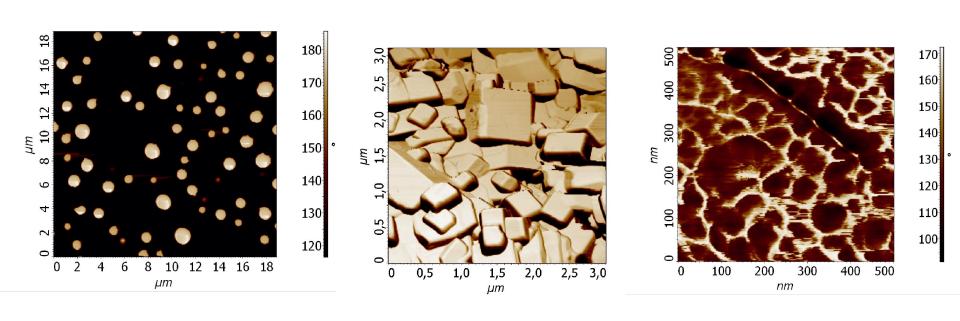


Видны отдельные частицы исходного материала Н ≈7 0-100нм, D ≈ 300-400нм

Структура аморфной пленки. Зерна Н≈15-20 нм, D≈100-300 нм

### Частицы ВаТіО<sub>3</sub> в силикатной связке

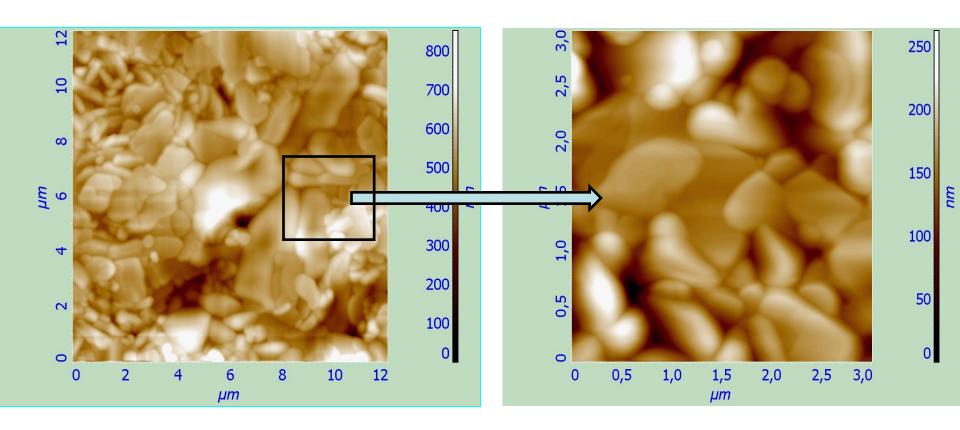
### Синтез в расплавах солей



Микро- Ультра- Нано-

### Спекание порошков титаната висмута

(нагрев с печью, отжиг 1000°C, 15 мин)

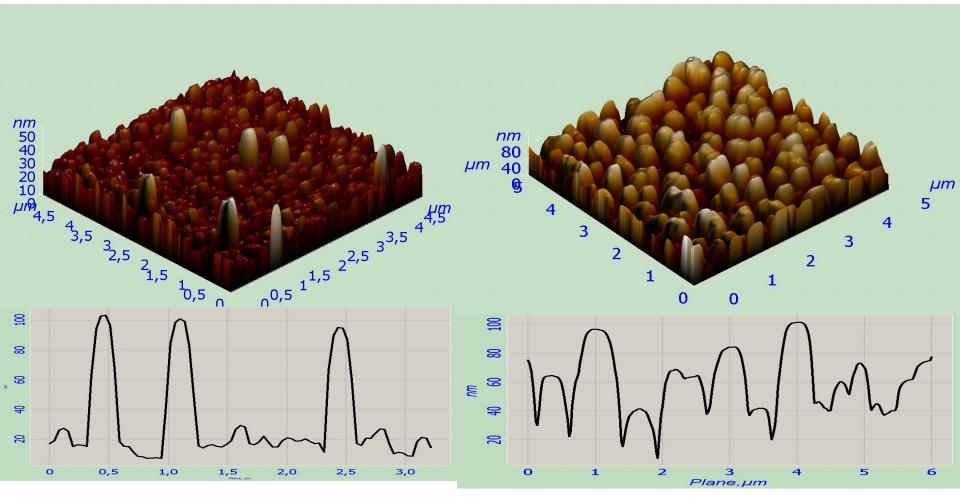


Укрупнение частиц в результате отжига от 100-200 нм до 2-3 мкм

### Влияние СВЧ обработки на топологию покрытия

Без СВЧ обработки

С использованием СВЧ обработки

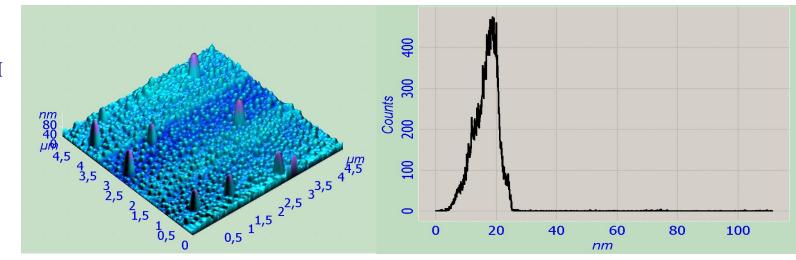


СВЧ обработка понижает общую шероховатость поверхности покрытия

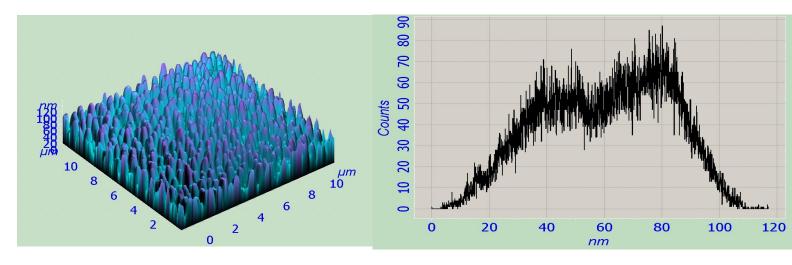
### Количественная характеризация шероховатости

### Влияние СВЧ обработки на шероховатость покрытий

**Обработки** нет

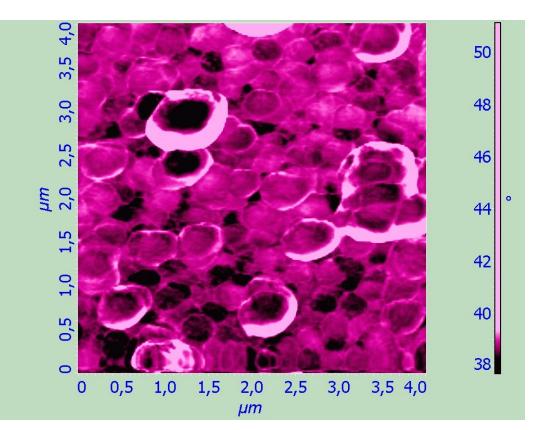


Обработка есть



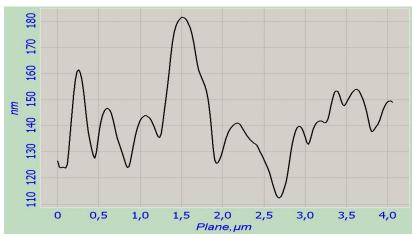
### Частицы Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в силикатной матрице

Степень защиты денежных знаков и ценных бумаг



# Магнитные и оптические свойства

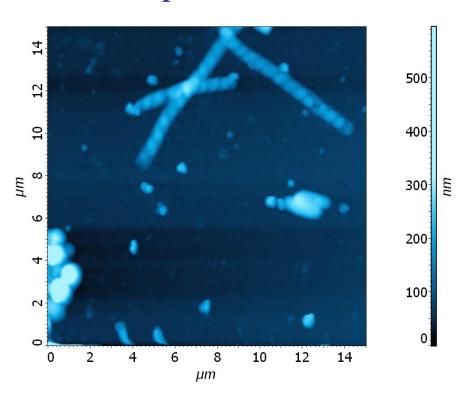
Размер частиц  $Fe_2O_3$ : D = 0.3-0.4 мкм; h = 70 нм



Плотная упаковка частиц  $\mathrm{Fe_2O_3}$ , низкая шероховатость поверхности Частицы прочно закреплены связкой, треки отсутствуют

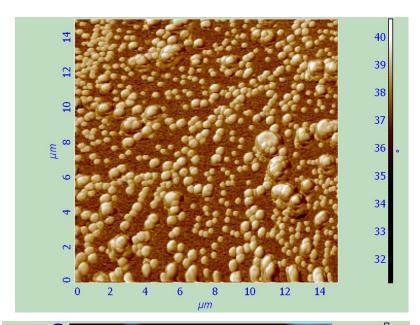
### Частицы ZrO<sub>2</sub> в силикатной матрице

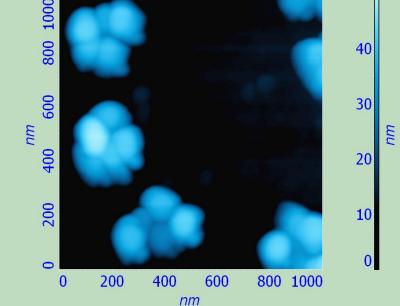
### Агломерация наночастиц



Цепочечные, ветвистые структуры из отдельных частиц и агломератов

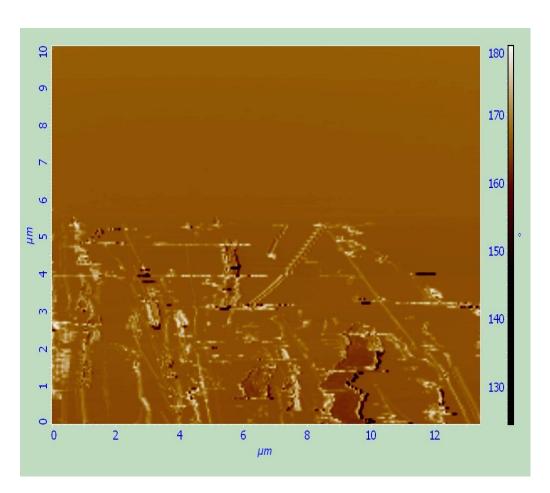
Размер частиц ZrO2 ~ 75 мкм



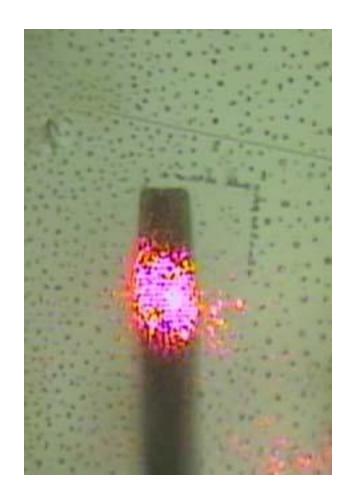


### Треки слабо закрепленных частиц

### Проблема фиксации частиц



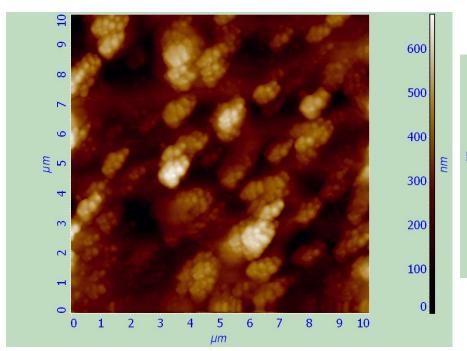
АСМ изображения треков

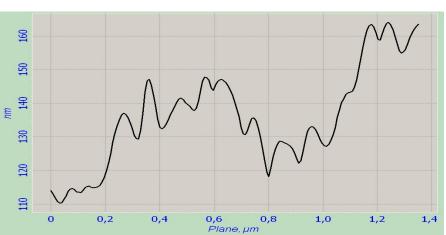


Оптическое изображение скана с кантилевером

### Характеризация порошковых наноматериалов

### Проблема фиксации частиц





### Частицы ZrO, закреплены силикатным золем

Размер частиц ZrO<sub>2</sub> ~ 75 нм

Размер частиц SiO<sub>2</sub> ~ 7 нм



# Институт химии силикатов РАН

Благодарим за внимание

